

資料11 ダイオキシン類に係る規制の状況

<p>根拠法令 ダイオキシン類対策特別措置法</p> <p>大気排出基準 第8条 (対象)法に基づく大気基準適用施設(5種類) (規制対象物質及び基準値)</p>	<p>規制対象物質 ダイオキシン類 基準値 [単位: ng-TEQ/m³N]</p> <table border="1" data-bbox="406 318 1407 772"> <thead> <tr> <th colspan="2">特定施設の種類の</th> <th>新設施設</th> <th>既存施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①焼結鋳(鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であつて、原料の処理能力が1ト/h以上のもの</td> <td></td> <td>0.1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>②製鋼用電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であつて、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>③亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの</td> <td></td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>④アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの</td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">⑤廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上)</td> <td>焼却能力</td> <td>4ト/h以上</td> <td>0.1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2~4ト/h</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2ト/h未満</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 許容限度は温度が零度であつて、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。</p>	特定施設の種類の		新設施設	既存施設	①焼結鋳(鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であつて、原料の処理能力が1ト/h以上のもの		0.1	1	②製鋼用電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であつて、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの		0.5	5	③亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの		1	10	④アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの		1	5	⑤廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上)	焼却能力	4ト/h以上	0.1	1		2~4ト/h	1	5		2ト/h未満	5	10
特定施設の種類の		新設施設	既存施設																															
①焼結鋳(鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であつて、原料の処理能力が1ト/h以上のもの		0.1	1																															
②製鋼用電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であつて、変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの		0.5	5																															
③亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋳炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの		1	10																															
④アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であつて、焙焼炉、乾燥炉にあつては原料の処理能力が0.5ト/h以上のもの、溶解炉にあつては容量が1ト以上のもの		1	5																															
⑤廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50kg/h以上)	焼却能力	4ト/h以上	0.1	1																														
		2~4ト/h	1	5																														
		2ト/h未満	5	10																														
<p>水質排出基準 第8条 (対象)法に基づく水質基準適用施設(19種類)を設置する工場又は事業場 (規制対象物質及び基準値(排水口))</p>	<p>規制対象物質 ダイオキシン類 基準値 [単位: pg-TEQ/L]</p> <table border="1" data-bbox="406 945 1407 1892"> <thead> <tr> <th>特定施設</th> <th>新設、既設施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設</td><td rowspan="19">10</td></tr> <tr><td>②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設</td></tr> <tr><td>③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑤担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑦カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑨4-クロロホルム酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフタレンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロインダノ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルオキサジン(別名ジキザンパイレット)製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンパイレット洗浄施設、熱風乾燥施設</td></tr> <tr><td>⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td></tr> <tr><td>⑬亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td></tr> <tr><td>⑭担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設</td></tr> <tr><td>⑮廃棄物焼却炉(大気排出基準に係る特定施設の⑤)から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの</td></tr> <tr><td>⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設</td></tr> <tr><td>⑰フロン類の破壊(プラズマを用いて破壊する方法等)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設</td></tr> <tr><td>⑱下水道終末処理施設(この表の①~⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)</td></tr> <tr><td>⑲この表の①~⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水(①~⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(⑲を除く。)</td></tr> </tbody> </table>	特定施設	新設、既設施設	①硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10	②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設	③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	⑤担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	⑦カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設	⑨4-クロロホルム酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設	⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフタレンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設	⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロインダノ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルオキサジン(別名ジキザンパイレット)製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンパイレット洗浄施設、熱風乾燥施設	⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑬亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑭担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設	⑮廃棄物焼却炉(大気排出基準に係る特定施設の⑤)から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの	⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設	⑰フロン類の破壊(プラズマを用いて破壊する方法等)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	⑱下水道終末処理施設(この表の①~⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)	⑲この表の①~⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水(①~⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(⑲を除く。)											
特定施設	新設、既設施設																																	
①硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10																																	
②カーバイド法アセチレンの製造用のアセチレン洗浄施設																																		
③硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																		
④アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																		
⑤担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設																																		
⑥塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設																																		
⑦カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設																																		
⑧クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設																																		
⑨4-クロロホルム酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																																		
⑩2,3-ジクロロ-1,4-ナフタレンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																																		
⑪8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロインダノ(3,2-b:3',2'-m)トリフェニルオキサジン(別名ジキザンパイレット)製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンパイレット洗浄施設、熱風乾燥施設																																		
⑫アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																		
⑬亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																		
⑭担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設																																		
⑮廃棄物焼却炉(大気排出基準に係る特定施設の⑤)から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であつて汚水又は廃液を排出するもの																																		
⑯廃棄物処理法施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設																																		
⑰フロン類の破壊(プラズマを用いて破壊する方法等)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																																		
⑱下水道終末処理施設(この表の①~⑰及び⑲の施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)																																		
⑲この表の①~⑰の施設を設置する工場又は事業場から排出される水(①~⑰の施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(⑲を除く。)																																		
<p>廃棄物焼却炉のばいじん、焼却灰等、燃え殻の処理</p>	<p>第24条 (対象)法に基づく大気基準適用施設のうち廃棄物焼却炉 (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 基準値 3ng-TEQ/g</p>	<p>第25条 (対象)廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場(管理型) (規制対象物質及び基準値) 規制対象物質 ダイオキシン類 放流水の水質基準値 10pg-TEQ/L</p>																																